

【公報種別】 特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載
【部門区分】 第 6 部門第 1 区分
【発行日】 令和 7 年 2 月 26 日 (2025.2.26)

【国際公開番号】 WO2023/243598
【出願番号】 特願 2024-528848 (P2024-528848)
【国際特許分類】

G 0 1 N 1/22(2006.01)

G 0 1 N 1/00(2006.01)

【F I】

G 0 1 N 1/22 B

G 0 1 N 1/00 1 0 1 X

G 0 1 N 1/00 E

10

【手続補正書】

【提出日】 令和 6 年 8 月 16 日 (2024.8.16)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】 特許請求の範囲

【補正対象項目名】 全文

【補正方法】 変更

20

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

吸着性成分を含むサンプルガスが流れるメイン流路と、
前記メイン流路を流れる前記サンプルガス中の吸着性成分を分析する分析計と、
前記分析計に校正ガスを供給する校正ガス流路と、
前記分析計の前記サンプルガスが通る流路に水分を含むパージガスを供給するパージガス流路とを備え、

前記メイン流路に前記サンプルガスを導入して前記分析計により前記サンプルガスを連続分析し、当該連続分析の途中において前記パージガス流路から前記分析計に前記パージガスを供給して前記分析計の前記サンプルガスが通る流路をパージし、続けて、前記校正ガス流路から前記分析計に校正ガスを供給して前記分析計を校正する、ガス連続分析システム。

30

【請求項 2】

前記パージガス流路は、大気を前記分析計の前記サンプルガスが通る流路に供給するものである、請求項 1 に記載のガス連続分析システム。

【請求項 3】

前記分析計は、前記吸着性成分である H F、H C l 又は N H ₃ を分析するものである、請求項 1 又は 2 に記載のガス連続分析システム。

【請求項 4】

40

前記校正ガス流路は、

ゼロガスを前記分析計に供給するゼロガス流路と、

スパンガスを前記分析計に供給するスパンガス流路とを有し、

前記排ガス連続分析システムは、前記連続分析の途中において前記パージガス流路から前記分析計に前記パージガスを供給して前記分析計の前記サンプルガスが通る流路をパージし、続けて、前記ゼロガス流路から前記分析計にゼロガスを供給して前記分析計をゼロ校正し、前記スパンガス流路から前記分析計にスパンガスを供給して前記分析計をスパン校正する、請求項 1 又は 2 に記載のガス連続分析システム。

【請求項 5】

前記校正ガス流路は、スパンガスを前記分析計に供給するものであり、

50

前記排ガス連続分析システムは、前記連続分析の途中において前記パージガス流路から前記分析計に前記パージガスを供給して前記分析計の前記サンプルガスが通る流路をパージするとともに前記分析計をゼロ校正し、続けて、前記校正ガス流路から前記分析計にスパンガスを供給して前記分析計をスパン校正する、請求項 1 又は 2 に記載のガス連続分析システム。

【請求項 6】

前記メイン流路において前記分析計の上流側に接続され、当該接続点から前記メイン流路の上流側に向けて第 2 パージガスを供給する第 2 パージ流路をさらに備え、

前記排ガス連続分析システムは、前記連続分析の終了後において前記第 2 パージ流路から前記第 2 パージガスを供給して、前記第 2 パージ流路の接続点よりも上流側をパージする、請求項 1 又は 2 に記載のガス連続分析システム。

10

【請求項 7】

前記分析計の上流側において前記メイン流路を流れる前記サンプルガスの一部を排出するオーバーフロー流路をさらに備える、請求項 1 又は 2 に記載のガス連続分析システム。

【請求項 8】

前記メイン流路において前記オーバーフロー流路の接続点及び前記分析計の間に絞り部が設けられ、前記メイン流路において前記分析計の下流側にメイン吸引ポンプが設けられており、

前記オーバーフロー流路にサブ吸引ポンプが設けられている、請求項 7 に記載のガス連続分析システム。

20

【請求項 9】

ダクト内を流れる吸着性成分を含むガスをサンプリングするサンプリング部と、

前記サンプリング部によりサンプリングされたサンプルガスが流れるメイン流路と、

前記メイン流路を流れる前記サンプルガス中の吸着性成分を分析するクロマトグラフ又は質量分析計と、

前記分析計の上流側において前記メイン流路を流れる前記サンプルガスの一部を排出するオーバーフロー流路とを備える、ガス連続分析システム。

【請求項 10】

吸着性成分を含むサンプルガスが流れるメイン流路と、前記メイン流路を流れる前記サンプルガス中の吸着性成分を分析する分析計と、前記分析計に校正ガスを供給する校正ガス流路と、前記分析計の前記サンプルガスが通る流路に水分を含むパージガスを供給するパージガス流路とを備える測定システムを用いたガス連続分析方法であって、

30

前記メイン流路に前記サンプルガスを導入して前記分析計により前記サンプルガスを連続分析し、当該連続分析の途中において前記パージガス流路から前記分析計に前記パージガスを供給して前記分析計の前記サンプルガスが通る流路をパージし、続けて、前記校正ガス流路から前記分析計に校正ガスを供給して前記分析計を校正する、ガス連続分析方法。

。

40